

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
C07D 471/04

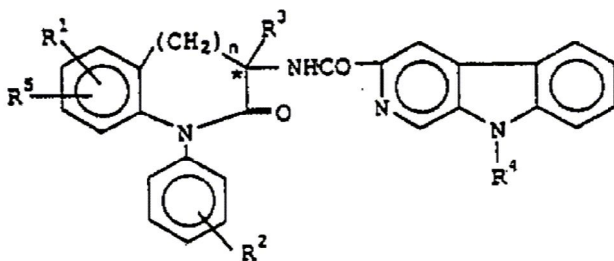
(11) 공개번호 특1993-0023366
(43) 공개일자 1993년 12월 18일

(21) 출원번호	특1993-0009381
(22) 출원일자	1993년 05월 27일
(30) 우선권주장	92-136819 1992년 05월 28일 일본 (JP)
(71) 출원인	다나베세이야구 가부시끼가이샤 지바타 이찌로 일본국 오오사카후 오오사카시 쥬오구 도쇼오마찌 3쵸메 2방 10고 야마다 고이찌로 일본국 사이다마켄 미나미사이따마군 시라오까마찌 신시라오까 3쵸메 34반 찌 7 히코따 마사따까 일본국 사이따마켄 시끼시가사와쵸 2쵸메 16방 19고 유라 다께시 일본국 효오고켄 다까라즈까시 나까노쵸 7방 1고 수미레 맨션 203고 시까노 도시로 일본국 사이따마켄 오미야시 기따부꾸로쵸 2쵸메 385반찌 나가사끼 마사끼 일본국 사이따마켄 우라와시 시라하따 4쵸메 1방 24-803고 이준구, 박해선
(72) 발명자	
(74) 대리인	

심사청구 : 없음

(54) β -카르볼린 유도체

요약



[식중, R¹은 수소원자, 저급 알킬기, 저급 알콕시기 또는 히드록시기를 나타내고; R⁵는 수소원자를 나타내거나 또는, R¹ 및 R⁵는 결합하여 저급 알킬렌디옥시기를 나타내고; R²는 수소원자, 할로겐원자, 저급 알콕시기 또는 히드록시기를 나타내며; R³는 수소원자, 카르바모일 저급 알킬기, 저급 알킬기, 카르복시 저급 알킬기 또는 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기를 나타내고; R⁴는 수소원자, 저급 알킬기, 카르복시 저급 알킬기, 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기, 저급 알카노일기, 아릴카르보닐기, 저급 알칸술포닐기, 저급 알콕시카르보닐기, 아르알킬기, 포르밀기 또는 디 (저급 알킬) 술포모일기를 나타내며; n은 0, 1 또는 2를 나타내고; 기호*는 부제 탄소 원자를 나타낸다.]

상기 식으로 표시되는 β -카르볼린 화합물 또는 약제학적으로 허용가능한 그의 염 및 그의 제조방법을 개시한다.

명세서

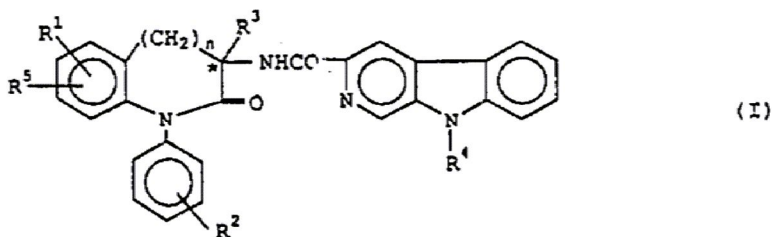
[발명의 명칭]

β -카르볼린 유도체

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1



[식중, R^1 은 수소원자, 저급 알킬기, 저급 알콕시기 또는 히드록시기를 나타내고; R^5 는 수소원자를 나타내거나, 또는 R^1 및 R^5 는 결합하여 저급 알킬렌 디옥기시기를 나타내고; R^2 는 수소원자, 할로겐원자, 저급 알콕시기 또는 히드록시기를 나타내며; R^3 는 수소원자, 카르바모일 저급 알킬기, 저급 알킬기, 카르복시 저급 알킬기 또는 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기를 나타내고; R^4 는 수소원자, 저급 알킬기, 카르복시 저급 알킬기, 저급 알콕시카르보닐기, 아르알킬기, 포르밀기 또는 디(저급 알킬) 술파모일기를 나타내며; n 은 0, 1 또는 2를 나타내고; 기호*는 부제 탄소원자를 나타낸다.]

상기 식으로 표시되는 β -카르볼린 화합물 또는 약제학적으로 허용가능한 그의 염.

청구항 2

제 1항에 있어서, 식 (1)의 화합물이 부제 탄소원자*를 기본으로 하는 광학 이성질체인 화합물.

청구항 3

제 1항에 있어서, R^1 이 수소원자, 저급 알킬기, 저급 알콕시기 또는 히드록시기이고, R^2 가 수소원자 또는 할로겐 원자이며, R^3 가 수소원자, 저급 알킬기, 카르복시 저급알킬기 또는 저급 알콕시카르보닐 저급알킬기이며, R^4 가 수소원자, 저급 알킬기 또는 저급 알카노일기이고, R^5 가 수소원인 화합물.

청구항 4

제 3항에 있어서, R^1 이 수소원자 또는 저급 알콕시기이고, R^2 가 수소원자 또는 할로겐 원자이며, R^3 가 수소원자, 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기이고, R^4 가 수소원자 또는 저급 알카노일기이며, R^5 가 수소원자인 화합물.

청구항 5

제 4항에 있어서, R^1 은 수소원자 또는 메톡시기이고, R^2 가 수소원자 또는 불소원자이며, R^3 가 수소원자, 메틸기 또는 메톡시카르보닐 에틸기이고, R^4 가 수소원자 또는 아세틸기이며, R^5 가 수소원자인 화합물.

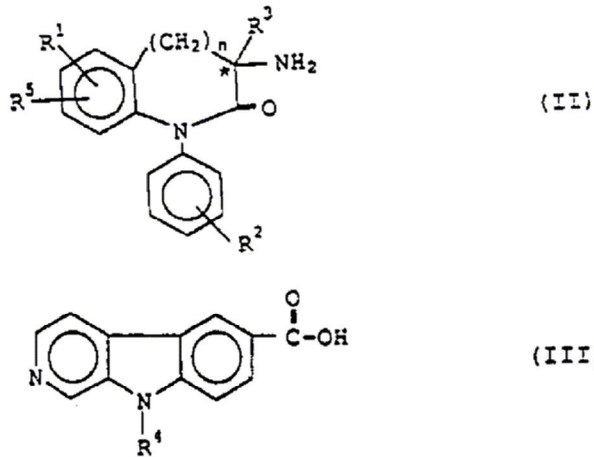
청구항 6

제 5항에 있어서, R^1 이 메톡시기이고 R^2 가 불소원자이며, R^3 가 메틸기이고, R^4 가 아세틸기이며, R^5 가 수소원자인 화합물.

청구항 7

제 6항에 있어서, n 이 0인 화합물.

청구항 8



[식중 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , n 및 $*$ 는 제 1항에서 정의한 바와 동일한 의미를 갖는다.]

상기 식(II)로 표시되는 아민 화합물 또는 그의 염과 상기식(III)으로 표시되는 카르복실산 화합물. 그의 반응성 유도체 또는 그의 염과 반응시키고, 필요하다면 수득한 화합물을 약제학적으로 허용가능한 그의 염으로 전환시키는 것을 포함하는 제 1항 기재의 화합물(I) 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염의 제조방법.

청구항 9

R^4 가 수소원자인 화합물(I)과 저급 알카노일화제를 반응시키는 것을 포함하는 R^4 가 저급 알코노일기인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 10

R^4 가 저급 알카노일기인 화합물(I)을 탈아실화 하는 것을 포함하는 R^4 가 수소원자인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 11

하나 이상의 R^1 및 R^2 가 저급 알콕시기인 화합물(I)을 탈알킬화하는 것을 포함하는 하나 이상의 R^1 및 R^2 가 히드록시기인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 12

하나 이상의 R^3 및 R^4 가 수소원자인 화합물(I)을 저급 알킬화제, 카르복시 저급 알킬화제 또는 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬화제와 반응시키는 것을 포함하는 하나 이상의 R^3 및 R^4 가 저급 알킬기, 카르복시 저급알킬기 또는 저급 아콕시카르보닐 저급 알킬기인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 13

하나 이상의 R^3 및 R^4 가 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기인 화합물(I)을 가수분해 하는 것을 포함하는 하나 이상의 R^3 및 R^4 가 카르복시 저급 알킬기인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 14

하나 이상의 R^3 및 R^4 가 카르복시 저급 알킬기인 화합물(I)을 에스테르화 하는 것을 포함하는 하나 이상의 R^3 및 R^4 가 저급 알콕시카르보닐 저급 알킬기인 제 1항 기재의 화합물(I)의 제조방법.

청구항 15

통상의 약제학적으로 허용가능한 담체 또는 희석제와 혼합된 제 1항 기재의 화합물(I)의 치료학적 유효량을 함유하는 약제학적 조성물.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.